(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 15. Juli 2004 (15.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/059695 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 21/00, 21/68
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/013388
- (22) Internationales Anmeldedatum:

28. November 2003 (28.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

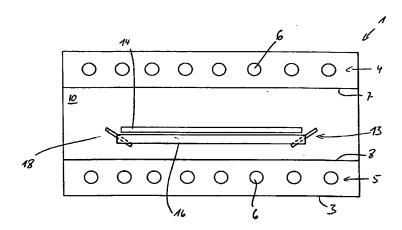
Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 102 60 672.2 23. Dezember 2002 (23.12.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): MATTSON THERMAL PRODUCTS GMBH [DE/DE]; Daimlerstrasse 10, 89160 Dornstadt (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FUNK, Klaus [DE/DE]; Edelweissstrasse 18, 85521 Ottobrunn (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: ULTRASONIC LEVITATION IN A RAPID THERMAL PROCESSING PLANT FOR WAFERS
- (54) Bezeichnung: ULTRASCHALLEVITATION IN EINER SCHNELLHEIZANLAGE FÜR WAFER



- (57) Abstract: The aim of the invention is to permit the rapid cooling of substrates in a rapid thermal processing plant. The invention thus provides a method for thermally treating discoid substrates, in particular semiconductor wafers, in a rapid thermal processing plant comprising at least one first radiation source, placed at a distance from the substrate, for heating at least one substrate. According to the invention, the substrate is heated in a heating phase and is cooled in a subsequent cooling phase and the substrate is held at a distance of between 50 µm and 1 mm, in particular between 150 and 500 µm from a heating/cooling plate at least for one period of the cooling phase. In order to eliminate problems caused by supporting elements, the invention discloses a device and a method for thermally treating discoid substrates, in particular semiconductor wafers, in a rapid thermal processing plant. In said device and method at least one substrate is heated in a heating phase by a radiation source that is placed at a distance from said substrate and is cooled in a subsequent cooling phase and the substrate is held by ultrasonic levitation in the rapid thermal processing plant during the thermal treatment.
- (57) Zusammenfassung: Um eine rasche Abkühlung von Substraten in einer Schnellheizanlage zu ermöglichen, sieht die vorliegend Erfindung ein Verfahren zum thermischen Behandeln von scheibenförmigen Substraten, insbesondere Halbleiterwafern, in einer Schnellheizanlage mit wenigstens einer vom Substrat beabstandete ersten Strahlungsquelle zum Erwärmen wenigstens

WO 2004/059695

TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 17. März 2005

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

eines Substrats vor, bei dem das Substrat in einer Heizphase erwärmt und einer darauf folgenden Kühlphase abgekühlt wird, und das Substrat wenigstens während eines Abschnitts der Kühlphase mit einem Abstand zwischen 50 µm und 1 mm, insbesondere zwischen 150 und 500 µm von einer Heiz/Kühlplatte beabstandet gehalten wird. Um durch Auflageelemente entstehenden Probleme zu eliminieren ist ferner eine Vorrichtung ein Verfahren zum thermischen Behandeln von scheibenförmigen Substraten, insbesondere Halbleiterwafern, in einer Schnellheizanlage vorgesehen, bei der bzw. bei dem wenigstens ein Substrat über eine vom Substrat beabstandete Strahlungsquelle in einer Heizphase erwärmt und einer darauf folgenden Abkühlphase abgekühlt wird und das Substrat während der thermischen Behandlung mittels Ultraschallevitation in der Schnellheizanlage gehalten wird.

International Application No PCT/EP 03/13388

PCT/EP 03/13388 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L21/00 H01L21/68 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 HO1L Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. US 2002/116836 A1 (MORAD ET AL.) 29 August 2002 (2002-08-29) Х 1,2 paragraphs [0029], [0038] Y 3,7,8, 26,51-53 WO 02/090222 A (ROBERT BOSCH GMBH) 3,7,8, 14 November 2002 (2002-11-14) 26,51-53 page 16, line 20 - page 17, line 15: figure 5 1 WO 00/61474 A (TECHNISCHE UNIVERSITÄT Α 1,26,51 MUNCHEN) 19 October 2000 (2000-10-19) abstract -/--Further documents are listed in the continuation of box C. X Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed Invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 13. 09. 2004 8 June 2004 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Oberle, T

International Application No
PCT/EP 03/13388

| | <u> </u> | PC1/EP 03/13388 | | |
|------------|--|-----------------|---------|--|
| | ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | • | |
| Category ° | egory ° Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. | | | |
| A | DATABASE WPI Section PQ, Week 200003 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class P43, AN 2000-033239 XP002277900 & JP 11 301832 A (TOSHIBA) 2 November 1999 (1999-11-02) abstract | | 1,26,51 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

International application No.
PCT/EP 03/13388

| Box I | Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet) | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons: | | | | | |
| 1. | Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: | | | | |
| 2. | Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically: | | | | |
| 3. | Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a). | | | | |
| Box II | Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet) | | | | |
| This Int | ernational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: | | | | |
| | see supplemental sheet | | | | |
| | | | | | |
| 1. | As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims. | | | | |
| 2. | As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee. | | | | |
| 3. | As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.: | | | | |
| 4. X | No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 1-8,11,12,22-33,36,37,41,47-64,69-73 | | | | |
| Remar | k on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees. | | | | |

The International Searching Authority has determined that this international application contains multiple (groups of) inventions, namely

- 1. Claims 1-8, 11, 12, 22, 23, 24-33, 36, 37, 41, 47-64, 69-73

 ultrasonic levitation in a system of rapid thermal processing of wafers.
- 2. Claims 9, 10, 16, 20, 21, 34, 35, 45, 46
 method of thermal treatment of substrates.
- 3. Claims 13-15, 17-19, 38-40, 42-44, 65-68

 permeability to light of a heating/cooling plate in a system of rapid thermal processing of wafers.

International Application No PCT/EP 03/13388

| Patent document cited in search report | Publication date | | Patent family member(s) | | Publication date |
|--|------------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|
| US 2002116836 | A1 29-08-2002 | US US | | A1 B1 | 24-01-2002 21-08-2001 |
| | | US | | B1 | 06-02-2001 |
| | | US | | A1 | 17-07-2003 |
| | | US | | A1 | 12-08-2004 |
| | | EP | 1085557 | | 21-03-2001 |
| • | | JP | | AZ A | 19-07-2001 |
| | | SG | 90167 | | 23-07-2002 |
| | | TW | | В | 01-09-2002 |
| | | ÜS | 2004003873 | | 08-01-2004 |
| | | | | | |
| WO 02090222 | A 14-11-2002 | DE | 10121742 | A1 | 23-01-2003 |
| NO OLOGOLLE | ,,,, | CN | | T | 17-12-2003 |
| | | WO | 02090222 | A1 | 14-11-2002 |
| | | EP | 1387808 | A1 | 11-02-2004 |
| • | | JP | 2004519346 | T | 02-07-2004 |
| | | TW | | В | 01-08-2003 |
| | | US | 2004070221 | A1 | 15-04-2004 |
| WO 0061474 | A 19-10-2000 | DE | 19916859 | C1 | 04-01-2001 |
| 30021, 1 | | ĀŪ | 5206800 | | 14-11-2000 |
| | | WO | | A1 | 19-10-2000 |
| | | EP | 1173375 | A1 | 23-01-2002 |
| | | US | 6647791 | B1 | 18-11-2003 |
| JP 11301832 | A 02-11-1999 | NON | E | | |

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/13388

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L21/00 H01L21/68

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

| C. ALS WE | SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN | | T |
|---|--|--|---|
| Kategorie° | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe | Betr. Anspruch Nr. | |
| Х | US 2002/116836 A1 (MORAD ET AL.) 29. August 2002 (2002-08-29) Absätze [0029], [0038] | | 1,2 |
| Υ | ADSUIZE [0023], [0030] | | 3,7,8, 26,51-53 |
| Υ | WO 02/090222 A (ROBERT BOSCH GMBH 14. November 2002 (2002-11-14) Seite 16, Zeile 20 - Seite 17, Ze Abbildung 5 | | 3,7,8, 26,51-53 |
| Α | Applituding 5 | 1 | |
| A | WO 00/61474 A (TECHNISCHE UNIVERSITÄT MUNCHEN) 19. Oktober 2000 (2000-10-19) Zusammenfassung | | 1,26,51 |
| | - | ·/ | |
| | tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen | X Siehe Anhang Patentfamilie | |
| "A" Veröffe aber "A" Veröffe schel ande soll o ausg "O" Veröff einel "P" Veröff dem | e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : sntlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen sidedatum veröffentlicht worden ist sntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie eführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht sntlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist | Veröffentlichungen dieser Kategorie diese Verbindung für elnen Fachma "&" Veröffentlichung, die Mitglied derseib | ant worden ist und mit der jur zum Verständnis des der so oder der ihr zugrundellegenden eutung; die beanspruchte Erfindun tilchung nicht als neu oder auf trachtet werden eutung; die beanspruchte Erfindun gkeit beruhend betrachtet nit einer oder mehreren anderen in Verbindung gebracht wird und en Patentfamille ist |
| | Abschlusses der internationalen Recherche 3. Juni 2004 | Absendedatum des internationalen t | |
| Name und | Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk | Bevollmächtigter Bediensteter | |
| | Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 | Oberle, T | |

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/13388

| | ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN | | | | |
|------------|--|---------|--|--|--|
| (ategorie° | orle* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. | | | | |
| 1 | DATABASE WPI Section PQ, Week 200003 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class P43, AN 2000-033239 XP002277900 & JP 11 301832 A (TOSHIBA) 2. November 1999 (1999-11-02) Zusammenfassung | 1,26,51 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | · | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | · | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/13388

| Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1) |
|--|
| Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt: |
| 1. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich |
| 2. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich |
| 3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind. |
| Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) |
| Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält: |
| siehe Zusatzblatt |
| Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeltig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche. |
| 2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert. |
| 3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr. |
| 4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt: 1-8,11,12,22-33,36,37,41,47-64,69-73 |
| Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch. |

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

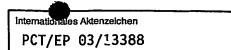
Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

- 1. Ansprüche: 1-8,11,12,22,23,24-33,36,37,41,47-64,69-73

 Ultraschallevitation in einer Schnellheizanlage für Wafer
- 2. Ansprüche: 9,10,16,20,21,34,35,45,46

 Verfahren zum thermischen Behandlen von Substraten
- 3. Ansprüche: 13-15,17-19, 38-40,42-44,65-68

 Lichtdurchlässigkeit einer Heiz/Kühlplatte in einer Schnellheizanlage für Wafer



| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | Datum der Veröffentlichung |
|---|-------------------------------|---|--|
| US 2002116836 A1 | 29-08-2002 | US 2002007567 A1 US 6276072 B1 US 6182376 B1 US 2003131495 A1 US 2004154185 A1 EP 1085557 A2 JP 2001196363 A SG 90167 A1 TW 501162 B US 2004003873 A1 | 24-01-2002 21-08-2001 06-02-2001 17-07-2003 12-08-2004 21-03-2001 19-07-2001 23-07-2002 01-09-2002 08-01-2004 |
| WO 02090222 A | 14-11-2002 | DE 10121742 A1 CN 1462253 T WO 02090222 A1 EP 1387808 A1 JP 2004519346 T TW 544382 B US 2004070221 A1 | 23-01-2003 17-12-2003 14-11-2002 11-02-2004 02-07-2004 01-08-2003 15-04-2004 |
| WO 0061474 A | 19-10-2000 | DE 19916859 C1 AU 5206800 A WO 0061474 A1 EP 1173375 A1 US 6647791 B1 | 04-01-2001 14-11-2000 19-10-2000 23-01-2002 18-11-2003 |
| JP 11301832 A | 02-11-1999 | KEINE | |